

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007267

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G03F1/00 G03F1/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G03F G06T G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>TOJO T ET AL: "MASK DEFECT INSPECTION METHOD BY DATABASE COMPARISON WITH 0.25-0.35MUM SENSITIVITY" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, Bd. 33, Nr. 12B, PART 1, 1. Dezember 1994 (1994-12-01), Seiten 7156-7162, XP000624356 ISSN: 0021-4922 Seite 7157, Spalte 2, Zeilen 18-37 Seite 7158, Spalte 1, Zeilen 9-22; Abbildung 3</p> <p>-----</p> <p>-/-</p>	1,2,7,8



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
21. Februar 2005	14/04/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Müller-Kirsch, L

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	BARTY A ET AL: "Aerial image microscope for the inspection of defects in EUV masks" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, Bd. 4889, 1. Oktober 2002 (2002-10-01), Seiten 1073-1084, XP002293092 ISSN: 0277-786X Seite 1080, Zeilen 1-12 -----	8
Y	US 4 633 504 A (WIHL ET AL) 30. Dezember 1986 (1986-12-30) Spalte 1, Zeilen 40-46 Spalte 2, Zeilen 11-41 -----	1-4, 6, 7
X	BUDD R A ET AL SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE): "A NEW MASK EVALUATION TOOL, THE MICROLITHOGRAPHY SIMULATION MICROSCOPE AERIAL IMAGE MEASUREMENT SYSTEM" OPTICAL / LASER MICROLITHOGRAPHY 7. SAN JOSE, MAR. 2 - 4, 1994, PROCEEDINGS OF SPIE. OPTICAL / LASER MICROLITHOGRAPHY, BELLINGHAM, SPIE, US, Bd. VOL. 2197, 2. März 1994 (1994-03-02), Seiten 530-540, XP000989214 ISBN: 0-8194-1492-1 Seite 532, Zeilen 21-24 Seite 533, Zeilen 7-21 -----	1, 5, 8
X	US 6 272 236 B1 (PIERRAT CHRISTOPHE ET AL) 7. August 2001 (2001-08-07) Spalte 6, Zeile 61 - Spalte 7, Zeile 7 Spalte 7, Zeile 61 - Spalte 8, Zeile 3; Abbildung 3 -----	1-3, 6-8
X	EP 1 081 489 A (APPLIED MATERIALS, INC) 7. März 2001 (2001-03-07) Absätze '0045!', '0046!', '0051!; Abbildung 2 Absatz '0055!' -----	8
X	US 5 576 829 A (SHIRAI SHI ET AL) 19. November 1996 (1996-11-19) Spalte 17, Zeilen 43-64; Abbildung 13 -----	8
X	US 2002/186879 A1 (HEMAR SHIRLEY ET AL) 12. Dezember 2002 (2002-12-12) Absätze '0041! - '0050!; Abbildungen 2,3 Absätze '0055! - '0059! -----	8

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007267

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4633504	A	30-12-1986	JP	6058220 B		03-08-1994
			JP	61082107 A		25-04-1986
US 6272236	B1	07-08-2001	US	6091845 A		18-07-2000
EP 1081489	A	07-03-2001	US	6466315 B1		15-10-2002
			DE	60016682 D1		20-01-2005
			EP	1081489 A2		07-03-2001
			JP	2001159810 A		12-06-2001
US 5576829	A	19-11-1996	JP	3047446 B2		29-05-2000
			JP	4146437 A		20-05-1992
			JP	4181251 A		29-06-1992
			JP	3047459 B2		29-05-2000
			JP	4181252 A		29-06-1992
US 2002186879	A1	12-12-2002	EP	1412816 A2		28-04-2004
			JP	2004533015 T		28-10-2004
			TW	548510 B		21-08-2003
			WO	02099533 A2		12-12-2002